

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年12月12日(12.12.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/252911 A1

(51) 国際特許分類:
C01B 33/107 (2006.01) B09B 3/40 (2022.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/018579

(22) 国際出願日: 2024年5月21日(21.05.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2023-095256 2023年6月9日(09.06.2023) JP

(71) 出願人: 株式会社 トクヤマ (TOKUYAMA CORPORATION) [JP/JP]; 〒7458648 山口県周南市御影町1番1号 Yamaguchi (JP).

(72) 発明者: 仲西 穂高 (NAKANISHI, Hodaka); 〒7458648 山口県周南市御影町1番1号 株式会社トクヤマ内 Yamaguchi (JP). 沖本 敦之 (OKIMOTO, Atsushi); 〒7458648 山口県周南市御影町1番1号 株式会社トクヤマ内 Yamaguchi (JP). 飯山 昭二 (IIYAMA, Shoji); 〒7458648 山口県周南市御影町1番1号 株式会社トクヤマ内 Yamaguchi (JP).

(74) 代理人: 弁理士法人 H A R A K E N Z O W O R L D P A T E N T & T R A D E M A R K (HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK); 〒5300041 大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2番6号 大和南森町ビル Osaka (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC,

EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(54) Title: CHLOROSILANE PRODUCTION METHOD

(54) 発明の名称: クロロシラン類の製造方法

(57) Abstract: The present disclosure provides a chlorosilane production method for generating a chlorosilane by reacting a silicon source with hydrogen chloride or with tetrachlorosilane and hydrogen. The chlorosilane production method is characterized in that the silicon source includes a monocrystalline silicon and/or a polycrystalline silicon recovered from solar panels. In 100 parts by mass of the silicon source, the contained amount of the monocrystalline silicon and/or the polycrystalline silicon is preferably 1-99 parts by mass.

(57) 要約: 本開示は、シリコン源と塩化水素、又は、テトラクロロシラン及び水素とを反応させてクロロシラン類を生成するクロロシラン類の製造方法であって、前記シリコン源が、太陽光パネルから回収された単結晶シリコン及び多結晶シリコンの少なくとも一種を含むことを特徴とするクロロシラン類の製造方法を提供する。前記シリコン源100質量部における、前記単結晶シリコン及び多結晶シリコンの少なくとも一種の含有量が1~99質量部であることが好ましい。

WO 2024/252911 A1